

---

## **Echipament PECVD si/sau sistem de depuneri in ultravid cu caracterizare integrata.**

I.D.: 3875722

---

|                 |          |            |                   |
|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Data publicarii | 07.10.14 | Coduri CPV | 42611000 51430000 |
|-----------------|----------|------------|-------------------|

---

Descriere: Lot 1. Echipament PECVD: Echipament pentru depunere chimica din faza de vapori asistata de plasma pentru realizarea materialelor pe baza de carbon. Echipamentul trebuie sa fie configurat in principal pentru procese de depunere/crestere pentru urmatoarele materiale: grafena, diamant nanocristalin (NCD), carbura de siliciu (SiC) si nanotuburi de carbon (CNT). Lot 2. Sistem de depuneri in ultravid cu caracterizare integrata: Sistem format din 3 module (echipamente) care sa indeplineasca urmatoarele functii: depunere de straturi epitaxiale din flux molecular; depunere de straturi atomice; depunere prin pulverizare catodica.

---